

目 次

日中共同研究者一覧

第1章 平成29年度 知的財産保護包括協力推進事業の概要	1
第1節 共同研究の背景と目的	2
第2節 共同研究の概要	3
第3節 研究者会議、ワークショップ、意見交換の概要	5
第2章 知財専門裁判所の在り方に関する研究	17
第1節 研究内容の要約	18
第2節 知的財産高等裁判所の設立以来	20
Ⅰ. 「知的財産高等裁判所の大合議制度の評価と課題」	
中山 一郎 教授（國學院大學）	20
Ⅱ. 「知的財産分野における近時の最高裁判決の傾向について」	
宮脇 正晴 教授（立命館大学）	40
第3節 知識産権専門法院の在り方	48
Ⅰ. 「中国における知識産権法院建設の理論と実践」	
呉 漢東 教授（中南財經政法大学）	48
Ⅱ. 「中国における知識産権法院の設置及び発展」	
李 明德 教授（中国社会科学院）	62
第3章 悪意の商標に関する研究	81
第1節 研究内容の要約	82
第2節 中国の制度現状から	84
Ⅰ. 「商標の抜け駆け登録抑制問題における商品化権—中日の学説と制度の比較」	
彭 学龍 教授（中南財經政法大学）	84
Ⅱ. 「商標の悪意ある冒認出願規制の日中比較研究」	
張 鵬 助理研究員（中国社会科学院）	96
第3節 日本の制度現状から	126
Ⅰ. 「悪意の商標出願と商標法の基本理念」	
小塚 莊一郎 教授（学習院大学）	126
Ⅱ. 「国内外の地名等を含む商標の商標登録出願の取扱いに関する研究」	
今村 哲也 准教授（明治大学）	140
第4章 部分意匠の保護に関する研究	163
第1節 研究内容の要約	164
第2節 日本の制度現状	166

I. 「部分意匠の類否判断について」	
茶園 成樹 教授（大阪大学）	166
II. 「部分意匠と全体意匠—その関係について」	
青木 大也 准教授（大阪大学）	178
第3節 中国における部分外観設計の保護	190
I. 「中国における部分外観設計保護の追加に関する研究」	
曹 新明 教授（中南財經政法大学）	190
II. 「外観設計制度における「部分要素」が全体判断原則に及ぼす影響」	
顧 昕 助理研究員（国家知識産権局知識産権発展研究センター）	202
III. 「部分外観設計の侵害判断に関する研究」	
管 育鷹 教授（中国社会科学院）	222
第5章 基礎調査概要	245

※ 本報告書の中国側研究者の報告書は、一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所が翻訳を担当した。なお、文中の訳注は□で表記している。

本報告書は、一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所 榎本英吾 研究第二部長、井手李咲 研究員、田村健一 主任研究員、亀井秀和 研究員、池本和博 主任研究員が担当した。